

## ABKÜRZUNGEN

Die folgende Tabelle faßt die verwendeten Abkürzungen zusammen:

<b>Abkürzung</b>	<b>Erläuterung</b>
(0 0 2l)	Miller-Notation der Netzebenenindizierung (hier: h, k = 0; da l ganzzahlig, ist der Millerindex $\ell = 2l$ hier gerade)
$c_{\perp}$	Kristallitorientierung mit der c-Achse senkrecht zum Substrat (001)
$c_{\parallel}$	Kristallitorientierung mit der c-Achse parallel zum Substrat (100)
EDXRD	Energiedispersive Röntgenbeugung
ERDA	Elastische Rückstreuanalyse
$F_{H_2S}/(F_{H_2S}+F_{Ar})$	Gasflußverhältnis des reaktiven Sputtergasgemisches
FT	Fouriertransformation
$MoS_x, WS_x$	Schwefelgehalt relativ zum Molybdän- bzw. Wolframgehalt
M	Sammelbegriff für die Übergangsmetalle Mo und W
$c_{tex}$	Texturparameter (normiert nach entsprechender JCPDS-Datei)
JCPDS	Joint Committee of Powder Diffraction Standards
JMA	Modell nach Johnson, Mehl und Avrami
p	Totaldruck in der Sputterkammer
RBS	Rutherford-Rückstreuung
REM	Rasterelektronenmikroskopie
Sigradur <sup>®</sup>	Produktname des verwendeten Glaskohlenstoffs
TEM	Transmissionselektronenmikroskopie
$t_{ges}$	Abscheidezeit eines Experiments
$\theta_0$	fester Beugungswinkel bei energiedispersiver Röntgenbeugung
$T_{Sub}$	Substrattemperatur
$U_{Sub}$	Substratvorspannung
$W_{DC}; W_{HF}$	Sputterleistung in Watt für DC- bzw. HF-Plasmaanregung
XTEM	Transmissionselektronenmikroskopie an Querschnittspräparaten

